

# Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0125U001795

Відкрита

Дата реєстрації: 21-03-2025

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



## 1. Загальні відомості

**Підстава для проведення робіт:** 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

**КПКВК:**

**Напрямок фінансування:** 2.2 - прикладні дослідження і розробки

### Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

**Загальний обсяг фінансування (тис. грн.):** 0.000

**У тому числі по роках (тис. грн.):**

Рік	Фінансування
-----	--------------

## 2. Замовник

**Назва організації:** Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 02070921

**Адреса:** проспект Берестейський, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна

**Підпорядкованість:** Міністерство освіти і науки України

**Телефон:** 380442367989

**Телефон:** 380442044862

**Телефон:** 380442049494

**E-mail:** mail@kpi.ua

**WWW:** <https://kpi.ua/>

### 3. Виконавець

**Назва організації:** Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

**Код ЄДРПОУ/ПН:** 02070921

**Підпорядкованість:** Міністерство освіти і науки України

**Адреса:** проспект Берестейський, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна

**Телефон:** 380442367989

**Телефон:** 380442044862

**Телефон:** 380442049494

**E-mail:** mail@kpi.ua

**WWW:** <https://kpi.ua/>

### 4. Співвиконавець

### 5. Науково-технічна робота

#### Назва роботи (укр)

Експериментальні методи оптичної пірометрії з компенсацією випромінювання та дефлектометрії для вимірювання параметрів епітаксійних напівпровідникових шарів

#### Назва роботи (англ)

Experimental methods of optical pyrometry with emissivity compensation and deflectometry for measuring parameters of epitaxial semiconductor layers

#### Мета роботи (укр)

Дослідження та розробка оптоелектронних систем реєстрації пірометра та дефлектометра для вимірювання параметрів напівпровідникових шарів в процесі епітаксійного росту

#### Мета роботи (англ)

Research and development of optoelectronic pyrometer and deflectometer registration systems for measuring parameters of semiconductor layers during epitaxial growth

#### Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

**Вид роботи:** 48 - прикладна

**Очікувані результати:** Аналітичні матеріали

**Галузь застосування:** Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

### 6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	01.2025	12.2027	Остаточний звіт	Дослідження та розробка оптоелектронних систем реєстрації пірометра та дефлектометра для вимірювання параметрів напівпровідникових шарів в процесі епітаксійного росту.

## 7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13.11, 47.33.33, 47.09.29, 59.41.33

Індекс УДК: 621.38.049.77.002; 621.375.82.002, 621.38.049.77, 621.315.592, 681.7.08:535.232

## 8. Заключні відомості

**Керівник організації:**

Стіренко Сергій Григорович (д. т. н., професор)

**Керівники роботи:**

Воронько Андрій Олександрович

**Відповідальний за подання документів:** Собецька Анна (Тел.: +38 (067) 266-60-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності  
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.